

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成16年10月14日(2004.10.14)

【公開番号】特開2001-191639(P2001-191639A)

【公開日】平成13年7月17日(2001.7.17)

【出願番号】特願2000-10075(P2000-10075)

【国際特許分類第7版】

B 4 1 M 5/00

B 4 1 J 2/01

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】

【提出日】平成15年9月30日(2003.9.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

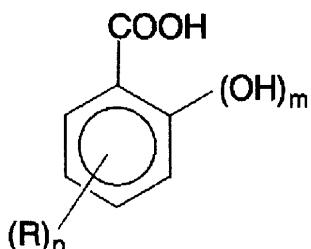
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

支持体上に気相法シリカを主として含有するインク受容層を設けたインクジェット記録用材料において、該インク受容層に下記化1の化合物を含有することを特徴とするインクジェット記録材料。

【化1】



(式中、Rはヒドロキシ基を除く置換可能な基を表し、mは0または1、nは0、1、2または3の整数を表す。)

【請求項2】

前記インク受容層が更にカチオン性化合物を含有する請求項1に記載のインクジェット記録材料。